

Ficha Trabajo Fin de Grado

Departamento:

ÓPTICA

Título del tema:

Fotolitografía

Plazas:

1

Objetivos:

Comprender el proceso fotolitográfico como la propagación de la luz a través de estructuras. Análisis numérico de algunas técnicas estándar para la grabación de estructuras por fotolitografía de proximidad.
--

Metodología:

Estudio de la bibliografía recomendada.

Revisión del proceso de difracción de la luz a través de estructuras micrométricas.

Comprensión del software para la propagación de la luz por las estructuras.

Desarrollo de algunos ejemplos numéricos.

Bibliografía:

1. H J. Levinson “Principles of Lithography” SPIE Press, (2005).
2. J. Tirapu “Analysis and Modeling of Photomask”.
3. “ Near-Fields in Sub-wavelength Deep Ultraviolet Lithography with Optical Proximity Corrections”, Tesis doctoral, 2004 (University of California).